PAT-NO:

JP363136018A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63136018 A

TITLE:

LASER OPTICAL SYSTEM

PUBN-DATE:

June 8, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MIYAGAWA, ICHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

FUJI PHOTO FILM CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP61283647

APPL-DATE: November 28, 1986

INT-CL (IPC): G02B027/46, H01S003/18

US-CL-CURRENT: 372/9

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain convergent light which is not influenced by a side lobe by providing a converging lens which converges light passed through a beam diameter adjusting member and a spatial filter which limits the passage of light in a linear direction and passes only light of 0th order converged on a specific position.

CONSTITUTION: The converging lens 4 is provided behind the beam diameter adjusting plate 3, light 1A' is converged in front of a final convergence position 7 temporarily, and the spatial filter 7 is

provided at this convergence position to cut the side lobe. The spatial filter 5 serves a light shield plate with an opening 5a to cut light 1b of 1st order and light 1c of the 2nd order while passing the light 1a of 0th order by the opening. The light la which is diverged by passing the spatial filter 5 is converged again by a converging lens 6 to form its image at the final convergence position 7. The light 1a is converged in a small spot even if a low output area at the convergence position 7 through the operation of the beam diameter adjusting plate 3 and becomes convergent light with no side lobe through the operation of the spatial filter 5. Consequently, an image having no ghost can be recorded.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-136018

filnt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)6月8日

G 02 B 27/46 H 01 S 3/18 8106-2H 7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

会発明の名称

レーザ光学系

②特 願 昭61-283647

郎

②出 願 昭61(1986)11月28日

砂発明者 宮川

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィルム

株式会社内

⑪出 願 人 富士写真フィルム株式

神奈川県南足柄市中沼210番地

会社

砂代 理 人 弁理士 柳田 征史

外2名

羽 相 岳

- 1.発明の名称 レーザ光学系
- 2. 特許請求の範囲
- 1) レーザ光源、該レーザ光源から発せられる光の光路上に設けられ、該光の中央部分の光のみを 過過させる間口を有するピーム径調整部材、該ピーム径調整部材を通過した光を収束させる収束レンズ、および前配光の収束位置の近傍に設けられ、少なくとも1次元方向に光のみを通過させる空間フィルタを備えたレーザ光学系。
- 2) 前記レーザ光瀬が半導体レーザであって印加される電流に応じて自然発光領域の光および同一 伊発振光を発し、前記ピーム経調整部材の開発の は 別角度に応じた強度分布における最大強度しから 該最大強度の 1 / 2 の強度 し / 2 までの範囲 合 る光を通過させる 同口の 大きさを 1 と した 場合に の 2~ 1.5であること特徴とする特許請求の範囲 第 1 項記載のレーザ光学系。

3. 発明の詳細な説明

(発明の分野)

本発明はレーザ光額を備えたレーザ光学系に関し、特に詳細にはレーザ光額から発せられた光を収束させた際に収束スポットのまわりにサイドロープが生じることのないレーザ光学系に関するものである。

(従来の技術)

ところで上記レーザ光学系においては、レーザ

特開昭63-136018(2)

半導体レーザから発せられる光には、レーザ発振光と自然発光領域の光の2つがあることが知られており、半導体レーザの駆動環境と、レーザ発振光と自然発光領域の光の関係は第8図に示すものとなっている。図示のグラフのうち、線 a は駆動電流と自然発光領域の光(以下、自然発光光と

がある走査記録装置に用いた場合には、低出力領域のビーム径が大きくなって走査の空間分解能が出るれてしまうといった問題が生じる。そこで発出し、半導体レーザから射出される光の光路上に光束の中央部分のみを過過させる同口を発出しているととができることができることができることを見出し、かかる調整板を備えた半導体レーザ光学系を先に出類した(特顧的 61-196352月)。

またビーム経調整板は、上述したように焦点課度を増大させたり、半導体レーザにおいて自然発光の収束スポット径の拡大を防止するために設けられる他、コリメータレンズ等光路上に設けられるレンズが、入射する光の径よりも小径である場合にはレンズ全体が関ロとして機能し、これらのレンズが実質的にビーム径調整部材となる場合がある。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、レーザ光源から発せられた光の 光路上に上記のようなビーム程調整部材を設ける 称する)の出力の関係を示し、線b は起動でる。の出力の関係を示していますもので発表を発体している。をはなるのは、半導体はし。を発生のは、2 ののは、2 ののは、3 ののは、3

ところで上記自然発光光は、レーザ発振光にくらべ様々の角度成分が混在しているため、収束レンズにより収束した際に、レーザ発振光ほど小さなスポット程に収束させることができないという不都合がある。このため、半導体レーザ光学系を、記録光を広いダイナミックレンジで変調して自然発光光が支配的な低出力領域の光まで用いる必要

と、かかる部材の同口の倫外部分により光がけられるため、ピーム径調整部材造過後の光を収囲を取取するの次光の周囲を設定収集するの次光の周囲の代表を表示して発生するのと、所定の位置に収集をして発生すると、次光をして発生すると、次出現すると、例えばレーザ光学系を変換した光を用い、ではいて、通過を行なう際に値像のゴーストがあらわれる等、種々の不都合が生じる。

そこで本発明は、ビーム後調整手段を備えたレーザ光学系において、サイドローブの影響のない 収束光を得ることのできるレーザ光学系を提供することを目的とするものである。

(周随点を解決するための手段)

本発明のレーザ光学系は、レーザ光源、上述した間口を有するピーム経調整部材とともに、該ピーム経調整部材を通過した光を収束させる収束レンズ、および前記光の収束位置近傍に設けられ、少なくとも1次元方向に光の通過を制限して所定の位置に収束した0次光のみを通過させる空間フ

特開昭63-136018 (3)

ィルタを備えたことを特徴とするものである。

なお、上記ピーム径調整手段の間口とは、 輪が部分において光にケラレが生じるものを意味し、 スリット等の他に、入別する光の径よりも小径の レンズ等も含むものとする。また、 収束位置近傍 とは、 収束位置を含む、 サイドローブの 遮断に有 効な範囲内の位置を意味するものである。

(作用)

上記のようなレーザ光学系によれば、ピーム怪 顕整手段を適適した光は一旦収束レンズにより収 束せしめれ、この収束位置において空間フィルタ を通過することにより0次光のみが取り出される ので、取り出された0次光を再び収束させれば、 サイドローブの生じない収束光を得ることができ る。

(実施例)

以下、図面を参照して本発明の実施例について 説明する。

第 1 図は木発明のレーザ光学系の一実施例である半導体レーザ光学系の概要を示す側面図である。

低出力領域の光の収束スポット程を小さくしてレ ーザ発振光の収束スポット径に近づけるために配 されており、開口38の大きさを小さくする程低出 力領域の光の収束スポット径を小さくすることが できる。収束スポット径縮小のための上記ピーム 怪調整板3の間口3aは、椴横共にその大きさが、 第2図に示す強度分布における最大強度しから最 大強度の1/2の強度L/2までの範囲にあるレ - 炉発振光を通過させる閉口の大きさを1とした 場合に 0.2~ 1.5の範囲内にあるように形成され ている。開口 3aの具体的な形状は、通過させる光 東中央部の光の光景を上記範囲内にあるようにす ることのできるものであれば、任意に形成してよ く、例えば第3図(a)に示すような長方形であ ってもよいし、第3阕(b)に示すような精円形 であってもよい。光1Aはピーム投調整板3を通 過した後、光路上に設けられた後述する複数の光 学素子を軽て最終的な収束位置7において収束す るが、閉口の大きさが上記 0.6である場合には、 レーザ発掘光が支配的な出力 3 m w 時の収束スポ 半導体レーザ1は電流を印加されることにより、この電流所に応じた発光型の光1Aを発し、半導体レーザ1から発振された光1Aは光路上に設けられたコリメータレンズ2に入射して平行光とされた後、中央部に閉口3aを有し、半導体レーザ1から発せられた光1Aのうち、光束の中央部分の光1A'のみを通過させるピーム程調整板3に入

前記ピーム経調整板3は自然発光光が支配的な

ところで上記のようにピーム怪調整板3を通過した光をそのまま収率させると、開口3aの倫外部によりけられる光によって、第5 図に示すように所定の位置に収束する0次光1aの周囲に1次光1b、2次光1cといったサイドローブが生じる。そこで本光学系においてはピーム径調整板3の背後に収

東レンズ4を設け、前述した最終的な収束位置7 の手前で一旦光1A′を収束させ、かつこの収束 位置に空間フィルタ5を設けて上記サイドロープ. をカットするようになっている。空間フィルタ 5 は一例として第4因に示すように開口5aを有する **遮光板となっており、間口により0次光 18を過過** させるとともに1次光1bや2次光1cを遮光するも のとなっている。開口5aの形状は前記ピーム怪器 整板3の開口3aに応じて決められ、ピーム径調整 板3が前述のように光を2次元方向について調整 するものである場合にはサイドロープも2次元方 向に発生するので、2次元方向にサイドロープを 遮光することのできる形状であることが必要であ る。例えばピーム経調整板3の頭口3aが第3図 (a) に示すように長方形である場合には、第4 図(a)に示すように空間フィルタ5の開口 5aも 長方形とし、開口3aが第3図(b)に示すように 楕円形である場合には第4図(b)に示すように 空間フィルタ5の開口5aも楕円形にすればよい。 またピーム経調整板3を通過した光は、それぞれ

間口 3aの 及手方向についてより小さく 集光するので、空間フィルタ 5 の間口 5aの 及手方向とピーム 投票 整板 3 の間口 3aの 及手方向は 直交するように 0 次光の間には 暗点 P があり、 暗点 P の 幅を W と すると、 間口 5aの幅は 2 次元方向についてそれ でれ W ± W / 10の 範囲内に 設定するのがよい。 間口 5a の 個がこの 範囲内であれば、 1 次光を通過させて 収束 した光のスポット形状が 私れるといった 不 都 合が生じない。

るものではなく、中央部分の光のみを選択的に選 過させる湖度分布フィルタであってもよい。また ピーム程調整板3が光の調整を1次元方向にのみ 行なうものである場合には、サイドロープは1次 元方向にのみ発生するので、空間フィルタも入射 する光を1次方向にのみフィルタリングするもの であればよい。

次に本発明による半導体レーザ光学系を光走査 装置に組み込んだ使用例を第7回を参照して説明 する。

図示の装置において、半導体レーザ11から発せられた光11Aはコリメータレンズ12を通過径、平行光となった後、開口13aを有するピーム形状が回路で示すように横長の特円形となっておけ、のは一ム形状がりの の の の の と で で が の と なって おり い の と なって が り の に と 下 方 向 に 締 め ら れ た む の と なって ガ 11 人 り 収 で 光 32 上 に 設 け ら れ た 収 束 レンズ 14 に よ り 収

束せしめられた後、収束位置に設けられた空間フ ィルタ15によりサイドローブが除去される。なお 光11A′のサイドロープは上下方向にのみ生じて おり、空間フィルタ15の開口15a は上下方向につ いてのみ、前述したようなサイドロープを除去す るのに適した幅となっており、左右方向について はその大きさが光11A′のピーム怪により大きく なっている。空間フィルタ 15を通過した光 11A′ は球面レンズ16により一旦平行光とされた後、シ リンドリカルレンズにより上下方向にのみ収束せ しめられて矢印A方向に回転する回転多面鎖 18に その駆動軸に垂直な線像として入射する。回転多 面號 18は光 11A′を主走査方向に反射偏向し、編 向された光11人′は2枚のレンズを相み合わせて なる f θレンズ 19を通過した後、光路上に主走査 方向に延びて設けられたシリンドリカルミラー20 を通過して、矢印8方向に搬送される(副走査さ れる)被走査而21上をくり返し矢印A′方向に主 走査する。シリンドリカルミラー20は、入射した 光 11 A′を被走査面 21上で翻走査方向にのみ収束

特開昭63-136018 (5)

させるものとなっており、また前記(θレンズ19 から前記被走査面21までの距離はf θレンズ19全 体の焦点距離と等しくなっている。このように本 装置においてはシリンドリカルレンズおよびミラ - 17, 20を配設し、光 11A′ が 回転多面額 18上で ~且副走査方向にのみ収束させることにより、回 転多面換18に面倒れや軸ぶれが生じても被走疫面 21上において光11A′の走査位置が別走査方向に ずれることなく、等ピッチで創走査方向にわれの ない走登線を形成することができるものとなって いる。また、かかる走査装置における被走査面21 上の収束スポット径の精度は、副走査方向につい て特に求められるとともに、サイドローブが闘走 査方向に発生すると、画像にゴーストが生じるた め、サイドロ~プについても酵走査方向について 極力除去する必要がある。本装置では、前述のよ うに匈転多面類入射前の光路において、翻走査方 向に相当する上下方向についてピーム役器整板13 により収束スポット径の調整を行なうとともに、 空間フィルタ 15により上下方向のサイドロープの

除去を行なっているので、被走査面 21上で、翻走 査方向にピームのポケやサイドロープ の発生のな い、高精度な走査を行なうことができる。

以上水発明のレーザ光学系について半導体レー **ザ光学系を例にあげて説明したが、本発明は、**無 点珠度を増大させるため等に開口を有するビーム 怪調整手段を光路上に設けた他のレーザ光学系に ついても適用できるものであり、レーザ光源は半 遊休レーザに限られるものではない。また、ピー ム抵調整手段の開口の顰ましい大きさもピーム径 の調整を行なう目的に応じて変化することは言う までもない。さらにピーム怪鋼整手段はピーム怪 の調整を目的として独立して設けられたものに限 らず、例えばコリメータレンズのほが入射する光 の推よりも小さく設定されている場合には、コリ メータレンズがピーム提調整手段として作用する ことになり、本発明における空間フィルタはこの ような場合にもサイドロープ除去手段として有効 である.

(発明の効果)

以上詳細に説明したように、本発明のレーザ光学系によれば、レーザ光源から発せられピーム怪調整手段を通過した光を一旦収束させ、収束位置に空間フィルタを配したことにより、サイドローブをカットすることができる。従って本発明の光学系を用いればサイドローブのない収束光によりゴーストのない画像の記録等を行なうことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は木発明レーザ光学系の一実施例である 半導体レーザ光学系を示す側面図、

第2例はレーザ発振光の放射角度に応じた強度 分布を示すグラフ、

第3図(a)、(b)はピーム経調整板の関ロの形状の例を示す観略図、

第4図(a)。(b)は空間フィルタの開口の 形状の例を示す概略図、

第5回は空間フィルタ未通過の収束光の強度分

布を示すグラフ、

第 6 図は空間フィルタ通過後の収束光の強度分布を示すグラフ、

第7回は水発明による半導体レーザ光学系を用いた光走査装置の斜視図、

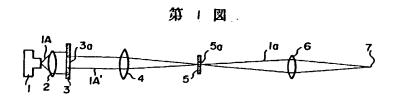
第8回は半導体レーザの駆動電流と、自然発光 光およびレーザ発振光の出力の関係を示すグラフ である。

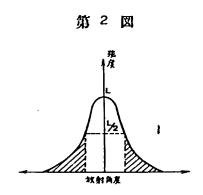
3 … ビーム径調整板 3a … 閉口

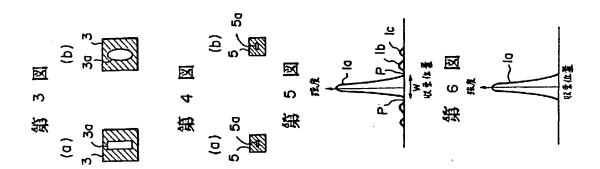
· 4 ··· 収束レンズ 5 ··· 空間フィルタ

特開昭63-136018 (6)

図面の浄む(内容に変更なし)







特開昭63-136018 (ア)

(自発) 手統補正鸖

特許庁長官 殿

第 7 図

第 8 図

出

昭和62年1月8日

1. 事件の表示

特額昭61-283647号



2. 発明の名称

レーザ光学系

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

住 所

神奈川県南足橋市中招210番地

富士写真フィルム株式会社

4.代理人

〒160 東京都港区六本木5-2-1

ほうらいやピル 7階 き (479) 2367

(7318)弁理士 柳 田 征 史 (ほか2名) (・

5. 補正命令の日付 な

6. 補正により増加する発明の数

7. 補正の対象

8. 補正の内容

手書き図面を暴入れ図面に補正します。

9. 承付書類

1通